

## NEW MULTI-FUNCTIONAL MICRO- AND NANOIMPRINT SOLUTION FROM EV GROUP OFFERS UNPRECEDENTED FLEXIBILITY FOR HIGH-VOLUME OPTICAL DEVICE MANUFACTURING – January 19, 2022

EV Group (EVG), a leading supplier of wafer bonding and lithography equipment for the MEMS, nanotechnology and semiconductor markets, today introduced the EVG®7300 automated SmartNIL® nanoimprint and wafer-level optics system. The EVG7300 is the company's most advanced solution to combine multiple UV-based process capabilities, such as nanoimprint lithography (NIL), lens molding and lens stacking (UV bonding), in a single platform. This industry-ready, multi-functional system is designed to serve advanced R&D and production needs for a wide range of emerging applications involving microand nano-patterning as well as functional layer stacking.



V集团企业技术总监托马斯·格林斯纳(Thomas Glinsner)表示:"EV集团深耕纳米压印	<b>D技术领</b>
二十余载,我们将继续在这一重要领域开拓创新,开发出新型解决方案,满足不断变化	的客户需
k。EVG7300是EV集团纳米压印解决方案系列的最新成员,将我们的SmartNIL全场压印	D技术与透
竟成型和透镜堆叠技术结合于顶级系统,拥有市场上最精确的调准和工艺参数控制功能	,为我们
的客户带来了前所未有的灵活性,足以满足行业研究和生产需求。"	
VG7300系统既可作为独立工具,也可用作EV集团HERCULES® NIL全面集成型UV-NIL	跟踪解决
5案中的集成模块。UV-NIL解决方案可添加额外的预处理步骤,例如清洁流程、抗蚀剂	涂层、烘
音或后处理等,以满足特定工艺的优化需求。EVG7300系统结合了调准平台改进、高精	度光学、
B点间隙控制、非接触式间隙测量和多点力控制等技术,达到了业内领先的调准精度(	最低可至
00纳米)。EVG7300是一种高度灵活的平台,提供三种工艺模式(透镜成型、透镜堆塑	昏和
martNIL纳米压印),支持从150毫米到300毫米晶圆的基板尺寸。该高效平台能够快速	東加载印戳
口晶圆、快速调准光学器件、提供高功率固化功能,且工具尺寸小巧,能够充分满足行	业对新型
晶圆级光学系统(WLO)产品的制造需求。	
SmartNIL®配备了增强现实波导和晶圆级显微镜头压印功能,使新的EVG®7300系统拥	相方广泛的
应用场景	
<b>在</b> 品上市信息	
V集团现已开始接受该系统的订单,同时,可在EV集团总部的NILPhotonics®技术中心	观看产品
发示。	
キチ EV 集团(EVG)	
V集团 (EVG) 是为半导体、微机电系统(MEMS)、化合物半导体、功率器件和纳米	支术器件
制造提供设备与工艺解决方案的领先供应商。主要产品包括:晶圆键合、薄晶圆处理、	光刻/光刻
纳米压印(NIL)与计量设备,以及光刻胶涂布机、清洗机和检测系统。EV集团成立于1	1980年,
J为全球各地的客户和合作伙伴网络提供服务与支持。	
论业分享本文,转载请保留出处:https://www.eechina.com/thread-782940-1-1.html 【打印本页	ų <b>1</b>
网友评论	
B 🚣 📰 🖏 # <> 🤪	高级模式
您需要登录后才可以发表评论 登录   立即注册	
发表评论	
关于我们 - 服务条款 - 使用指南 - 站点地图 - 友忖	情链接 - 联

https://www.eechina.com/thread-782940-1-1.html